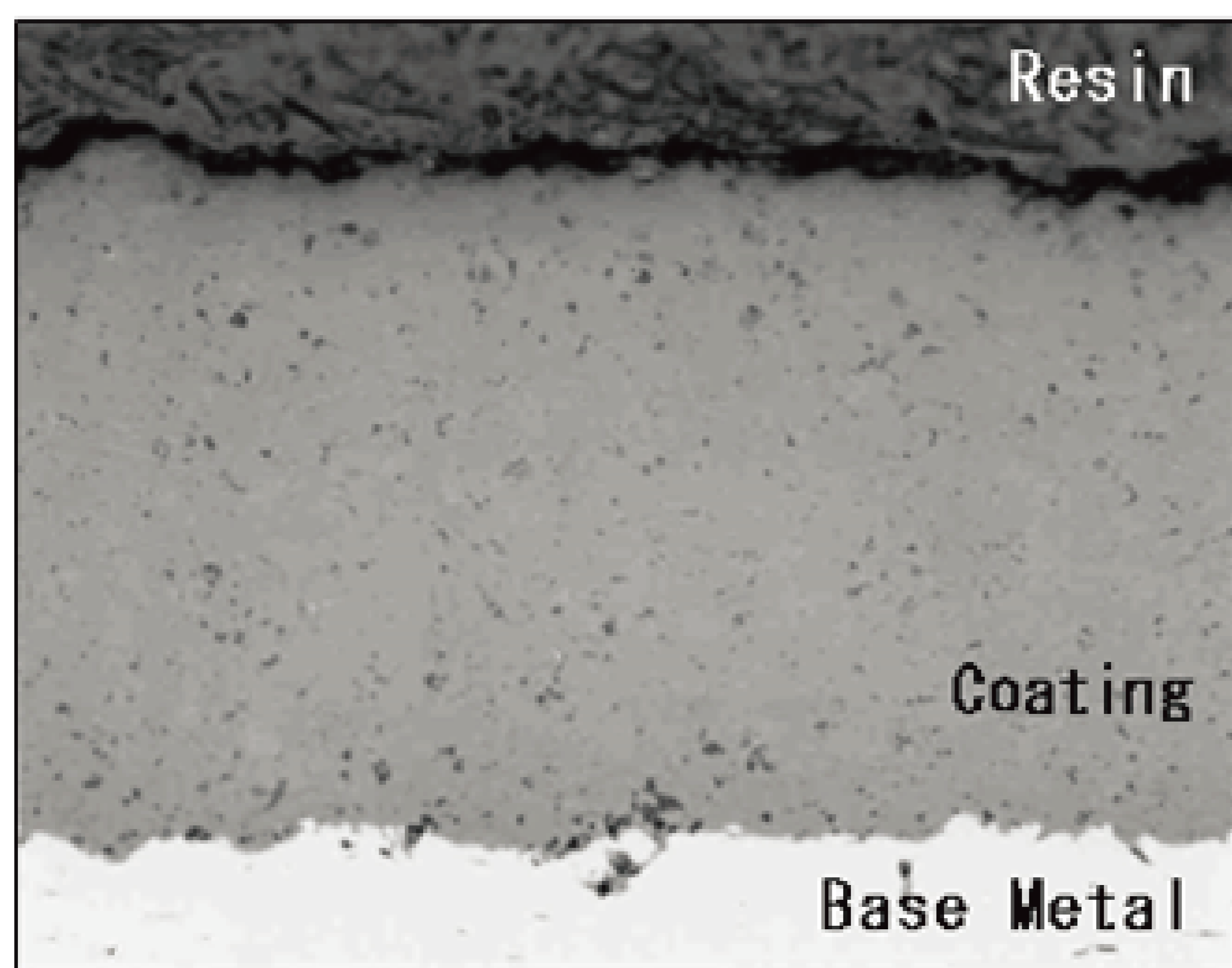


溶射応用例

半導体・FPD 製造装置への溶射加工

半導体・FPD 製造装置に有用な高耐食セラミックコーティングをご提案致します。

Linde AMT プラズマ溶射法による緻密で高接着力のコーティングは、一般的には溶射が困難とされるイットリア、アルミナ、窒化アルミ他で多くの加工実績があります。



溶射皮膜断面 (溶射材料: アルミナ)

溶射材料

Y_2O_3 , Al_2O_3 , $Al_2O_3-TiO_2$, その他

基材材質

アルミ、アルミナセラミックス、
窒化アルミ、石英、その他

溶射皮膜の特長

- ✓ 緻密で高密着のコーティングによりセラミック基材にも適用可能
- ✓ 高純度コーティング (純度 99.9% 以上)
- ✓ 再現性に優れる (航空機部品と同様のプロセス管理、品質管理)

チャンバー部品の寿命を大幅に伸ばすことが可能

設備稼働率の向上

パーティクル減 / 生産歩留まり改善

生産コスト低減の可能性をご提案